

Wir laden Sie herzlich ein  
zum

## Workshop 2012 Nano- und Oberflächentechnologien

**Ort:** Westsächsische Hochschule  
Zwickau

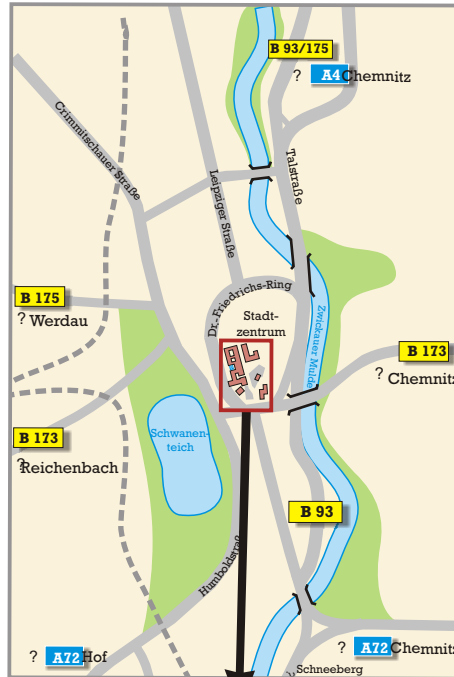
**Raum:** Aula; Peter-Breuer-Str. 3

**Datum:** Donnerstag, 08.11.2012

**Beginn:** 9.00 Uhr

**Ende:** ca. 16.30 Uhr

Anfahrt:



© ZKI - Zentrum für Kommunikationstechnik und Informationsverarbeitung



Parkmöglichkeit: Tiefgarage Kornmarkt (Einfahrt Schillerstraße)



Westsächsische Hochschule Zwickau  
University of Applied Sciences



# Einladung

Leopold-Institut für Angewandte  
Naturwissenschaften  
- LIAN -

Workshop 2012

## Nano- und Oberflächentechnologien

8. November 2012

# Teilnahmebestätigung

Ja, wir nehmen mit \_\_\_ Person(en) am Workshop teil.

Name \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_

Institution, Firma \_\_\_\_\_

PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Antwort möglichst bis 26. Oktober 2012

## Anmeldung und Information:

Westfälische Hochschule Zwickau  
Fakultät Physikalische Technik/Informatik  
LIAN - Leopold-Institut für Angewandte  
Naturwissenschaften,  
Dr.-Friedrichs-Ring 2A  
08056 Zwickau  
Telefon: 0375 536 1501  
Fax: 0375 536 1503  
Ansprechpartnerin: Frau Zimmermann  
E-Mail: [Yvonne.Zimmermann@fh-zwickau.de](mailto:Yvonne.Zimmermann@fh-zwickau.de)

# Programm

Moderation: Prof. Dr. H.-D. Schnabel

- 9.00 **Begrüßung durch den Rektor der Westsächsischen Hochschule Zwickau**  
Prof. Dr. G. Krauthelm
- 9.10 U. Schröder, NaMLab gGmbH Dresden  
**ALD für zukünftige Bauelemente: Optimierung der strukturellen und elektrischen Eigenschaften**
- 9.45 J. Sundquist, Fraunhofer-CNT, Dresden  
**Entwicklung von ALD-Precursoren, Prozesse und 300 mm Anlagen für die Massenfertigung von MIM-Speichermodulen (DRAM, eDRAM, FeFET, FRAM) und High-Performance-Transistoren (HKMG)**
- 10.10 A. Neidhardt, Westsächsische Hochschule Zwickau  
**ALD-Beschichtungen für tribologische und röntgenoptische Anwendungen**
- 10.35 B. Abendroth, TU BA Freiberg  
**Mikrostrukturuntersuchungen von SrTiO<sub>3</sub>-ALD Schichten**
- 11.00 Kaffeepause
- 11.20 Ch. Hoßbach, TU Dresden  
**In-situ-Charakterisierung bei der Atomlagenabscheidung**
- 11.45 M. Krug, Fraunhofer IKTS, Dresden  
**ALD-Beschichtungen am Fraunhofer IKTS Dresden**
- 12.10 St. Knohl, TU Chemnitz  
**Atomlagenabscheidung anorganischer Schichten auf Kohlefasern**
- 12.35 Th. Gebel, DTF Technology GmbH, Dresden  
**Flash Lamp Annealing (FLA): Hochtemperatur Prozesse im (sub) Millisekundenbereich für die Behandlung von Nanoschichten auf wärmeempfindlichen Substraten (z. B. Glas, PET-Folie)**

Moderation: Prof. Dr. D. Schondelmaier

- 13.00 Mittagspause
- 14.00 G. Salvan, TU Chemnitz  
**Magneto-optical Kerr Effect spectroscopy characterization of Ni/ALD-Cu<sub>2</sub>O heterostructures**
- 14.35 M. Schoengen, Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH, Berlin  
**Herstellung von Photonisch-Plasmonischen Hybridstrukturen mittels Elektronenstrahl-lithographie**
- 15.10 X. Thrun, Fraunhofer-CNT, Dresden  
**Marathon electron beam exposure for manufacturing of large area silicon based NIL master**
- 15.45 M. Schönfeld, J. Saupe, St. Schubert, J. Vogel, J. Grimm, Westsächsische Hochschule Zwickau  
**Charakterisierung von lithographisch erzeugten periodischen Gitterstrukturen aus polymeren Materialien mit Hilfe von SU8-AFM-Cantilevern**

## Tagungsgebühr:

Als Tagungsgebühr wird pro Person ein Beitrag von 25 Euro erhoben, der bitte bis zum 26.10.2012 auf das unten genannte Konto zu überweisen ist. Studierende, WHZ-Mitarbeiter und Vortragende sind beitragsfrei.

## Bankverbindung:

Empfänger: Hauptkasse des Freistaates Sachsen (Außenstelle Chemnitz)

Kreditinstitut: Ostsächsische Sparkasse Dresden

Konto-Nr.: 3153011370

BLZ: 850 503 00

**Verwendungszweck: 7040/00214-1 (bitte unbedingt angeben)**

